



S300

ION SPUTTER COATER

高真空离子溅射仪

The S300 is a high-vacuum ion sputtering system based on magnetron sputtering. It uses a turbomolecular pump and oil-free diaphragm pump to achieve a clean vacuum of 10^{-4} Pa. With its rotating sample stage, it can uniformly coat conductive films on up to 12-inch wafers using a small 2-inch cathode, reducing the cost of noble metal targets. Ideal for preparing samples for FESEM, it supports sputtering gold, platinum, and other reactive metals. The system is user-friendly with touch screen control and plug-and-play functionality.

S300是一款大面积喷镀高真空离子溅射仪，基于磁控溅射原理，采用涡轮分子泵与无油隔膜泵组合，实现 10^{-4} Pa量级的洁净真空。配备自主研发的旋转样品台，只需要小尺寸的2英寸阴极（大幅节约昂贵的贵金属靶材购买成本）就可在最大12英寸晶圆面积内均匀稳定地沉积导电膜，适用于超高分辨率场发射电镜样品的喷金、铂及其它易氧化金属喷镀。触摸屏控制，即插即用。



磁控溅射
减少热损伤

高真空无油泵组
洁净无污染

旋转样品台

大面积喷镀 12英寸

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan ,

Shenzhen, China

www.suproinst.com

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
适用场景	大面积高分辨/超高分辨 场发射电镜 FESEM 导电膜喷镀
真空泵组	涡轮分子泵+无油隔膜泵
抽速	≥ 隔膜泵 1.5 m ³ /h + 分子泵 80L/S
极限真空	10 ⁻⁴ Pa 量级
工作气压	典型值 0.3-1 Pa
气体控制	恒流控制, MFC气体质量流量控制器 (50 SCCM N ₂)
启动时间	< 5-10 Min 到10 ⁻³ Pa 量级
溅射计时	0-600S
真空规	高真空复合真空计【大气压到10 ⁻⁵ Pa 量级】
腔室尺寸	~ Ø350 *100 mm
样品台	Ø300 mm 旋转样品台, 最大可以放置12英寸晶圆 旋转转速: 5-30RPM 连续可调 靶基距50-80 mm可调
溅射靶材	靶材尺寸 Ø50 * 0.2-1 mm/2只 贵金属: Au、Pt、Pd、Ir等 易氧化金属: W、Cr、Ag等
溅射电源	恒功率DC溅射电源 Max. 30W , Max. 100 mA, 0-800 V DC
进气口	Ø6 mm 气管
操作方式	触摸屏控制, 控制系统提供互锁保护功能
尺寸重量	~450mm长 *500mm深 *450 mm高 主机~50 kg
电源	220V AC, 500W Max.
质保	一年
备注	所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司

地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009

电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205

邮件: sales@suproinst.com

www.suproinst.com

速普仪器(太仓)有限公司

地址: 苏州市太仓健雄路大学科技园11号楼1003

邮件: zkchang@suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司(北京办)

地址: 北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室